

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005 年 9 月 15 日 (15.09.2005)

PCT

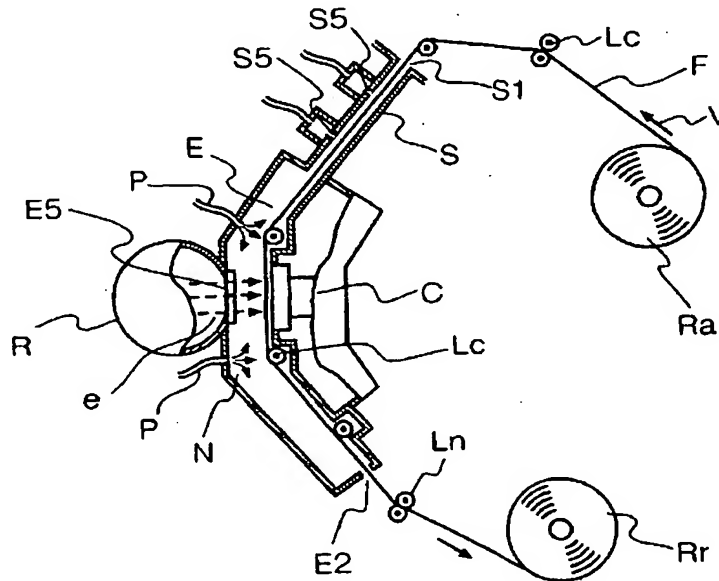
(10) 国際公開番号  
WO 2005/086176 A1

- (51) 国際特許分類<sup>7</sup>: G21K 5/04, B05D 3/06, B29C 35/08, G21K 5/00, 5/10 [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2005/004092 (72) 発明者; および  
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中尾 誠太郎 (NAKAO, Seitaro) [JP/JP]; 〒1628001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内 Tokyo (JP).
- (22) 国際出願日: 2005 年 3 月 9 日 (09.03.2005) (74) 代理人: 山本 晃司, 外 (YAMAMOTO, Koji et al.); 〒1040031 東京都中央区京橋一丁目 16 番 10 号 オークビル京橋 4 階 東京セントラル特許事務所内 Tokyo (JP).
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ: 特願2004-065263 2004 年 3 月 9 日 (09.03.2004) JP (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 大日本印刷株式会社 (DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.)

[続葉有]

(54) Title: ELECTRON BEAM IRRADIATION DEVICE

(54) 発明の名称: 電子線照射装置



(57) Abstract: An electron beam irradiation device comprising at least an electron beam generation unit (R), an irradiation chamber (E) for irradiating an object (F) with an electron beam, and an oxygen cutoff unit (S) for spraying an inert gas (N) to the object (F) on the upstream side of the irradiation chamber, wherein the oxygen cutoff unit is designed so that the gap  $W_s$  between partitions across the object is smaller than the gap  $W_e$  between partitions across the object in the irradiation chamber ( $W_s < W_e$ ), and the gap  $W_s$  is made uniform or almost uniform throughout the entire area of the oxygen cutoff unit, and spray slits (S5) for spraying an inert gas to the treating surface of the object are provided in a partition with no projection nor recess involved.

(57) 要約: 電子線発生部 R、被照射体 F に電子線を照射する照射室 E、照射室上流側で被照射体 F に不活性気体 N を吹付ける酸素遮断部 S、を少なくとも備える電子線照射装置について、

[続葉有]